PREVENTING METHOD OF GENERATION AND STICKING OF ALGAEIN SEWAGE TREATMENT

Patent number:

JP58128113

Publication date:

1983-07-30

Inventor:

ITOU HAJIME; others: 02

Applicant:

HITACHI KIDEN KOGYO KK

Classification:

- International:

B01D21/02; C02F1/36

- european:

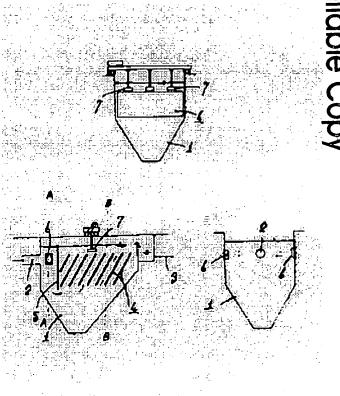
Application number:

JP19820010627 19820125

Priority number(s):

Abstract of **JP58128113**

PURPOSE: To prevent the generation and sticking of algae on settling accelerating plates, etc. by irradiating two kinds of ultrasonic waves differing in frequencies to the inflow port in the settling zone of a settling tank provided with the settling accelerating plates, the settling zone and the outflow side thereof. CONSTITUTION: The raw water admitted into a settling tank 1 for sewage treatment through an inflow port 2 at one end thereof passes below a partition plate 5, and flows from the inflow zone out into a settling zone provided with settling accelerating plates 4. The sewage after the treatment is discharged through an outflow port 3. Here, ultrasonic waves of respectively relatively high on low frequencies are irradiated from the ultrasonic wave generators 6, 7 in the inlet 2, the settling zone and the outflow side thereof toward the inflow sewage and the plate 4, respectively. Then, the swarmers which are a kind of spores having a flag gelum trying to flow into the settling zone are sterilized and removed by the generated H2O2 and stick to the plates 4. In the stage when the swarmers propagate by sticking to the plates 4 and germinate to form algae, the algae are removed from the plates 4 by the purification effect of cavitation.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

(19) 日本国特許庁 (JP)

40特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭58—128113

(1) Int. Cl.³
B 01 D 21/02
C 02 F 1/36

識別記号

庁内整理番号 6525-4D 6685-4D 砂公開 昭和58年(1983)7月30日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

⑤下水処理における藻の発生及び付着防止方法

20特 顧

願 昭57—10627

図出

願 昭57(1982)1月25日

⑰発明 者伊藤一

尼崎市下坂部3丁目11番1号日

立機電工業株式会社内

加発 明 者 伏尾正則

尼崎市下坂部3丁目11番1号日 立機電工業株式会社内

仍発 明 者 長川秀実

尼崎市下坂部 3 丁目11番 1 号日

立機電工業株式会社内

⑪出 願 人 日立機電工業株式会社

尼崎市下坂部3丁目11番1号

個代 理 人 弁理士 林清明

外1名

朔 稲 書

1. 発明の名称

下水処理における 薬の発生及び 付着防止方法 2. 条件請求の 範囲

下水処理の沈降促進被を設置した沈殿槽に於て 沈降促進板を設けた沈降ゾーンの施入口にて比較 的周波数の高い超音波を混入汚水に対して照射し 次いで、沈降ゾーン及び沈降ゾーン施出側にで比 数的周波数の低い超音波を沈降促進板に向って照射し、之等周波数の異なる二種の超音波にて北降 促進板等への緩の発生及びその付着を未然にが止 するようになしたことを特徴とする下水処理にか ける裏の発生及び付着防止方法。

3.発明の詳細な説明

本発明は下水処理に於て周波数の異なる二種の 超音波で用いて沈殿権の沈降促進板等への深の発 生及びその付着を防止する方法に関するものであ る。

従来下水処理に於て沈殿槽が用いられるが、この沈殿槽には走入汚水中の汚泥等の有根、無根の

固形物を効率的に沈降餘去すっため即ち沈殿効率 同上のため沈降促進板が設置される。

しかしこの

たいでは、

ないでは、

ないでは、
はいでは、
はいでは、

ないでは、
はいでは、
はいではいでは、
はいではいでは、
はいでは、
はいでは、
はいではいでは、
はいでは、

本発明はこれに鑑みてましたものである。

下水処理にあたって用いられる沈殿槽の化降促進板に付着し、その効率を低下せしめる巣のうち、問題となるのは主に緑巣である。この緑巣の多くは無性生殖を行なって増殖することは周知である。そしてこれは普通避走子形成によるものが多い、この避走子は植物細胞であっても細胞壁がなく原形質膜だけである。又紹音波によって生じるキャ

持開昭58-128113(2)

ピテーション作用があるが、これは物理的作用としての免浄作用と化学的作用としての過酸化水素(H2 O2)の生成とがある。そしてこの免浄作用は20 KHz ~ 30 KHz ・ 比較的周波数の低い方が波波も少く効率が良くまた過酸化水素は強い酸却力を有し、微生物の原形質膜と直接化合して設置作用を有するが、この過酸化水素の発生は 300~500 KHz の比較的周波数の高い方が効率が良い。

本発明は上述の点に着限してなされたもので以下因示の一実施例に基づいて説明する。

図に於て1は下水処理の比較値で、この一端に 原水を定入する流入口2、他端に処理後の汚水を 排出する提出口3を設けると共にその内部には 降促進板4を設ける。図示の実施例では設ける を傾斜せしめているが、水平であつても とのではないるが、水平であって、 とのではないでである。 とのではないではないではないではないである。 とのではないである。 でのではないである。 でのではないではないではないではないである。 とのではないではないではないである。 とのではないではないではないである。 とのではないではないではないではないである。 を設けたは呼ゾーンと定入プーンとを分けるようにないよりにないます。

して進定子が増殖され番が発生する段階で、 沈降 ゾーンに設けられた超音波発生装置 7 にて 2 0 ~ 3 0 KHz の比較的周波数の低い超音波を沈降促進 板に向って履射することによりこれにて生じたキャピテーションによる洗浄作用で付着番を沈降促 進収より除去するものである。

との超音複発生要量 7 による超音波の照射は沈降 促進板に裏の付着が生じ始めた頃に行るうが、常 時限射するようにしてもよい。

 また化降促進板を設度した沈設権において沈設ソーンの流入口に比較的周波数の高い超音波を発生する発生装金を超音波が流入汚水に対して服射するようにして設置する。そして沈設ソーンを出ている発生変化向けて服射するようにして設置する。とれらの発生装置も、7は固定でも又移動させてもよい。 はたは、周波数可変の発生装置を沈成ソーンに対し、自在に移動させてもよい。

従って上述の如く構成する比段権へ原水をその 流入口より供給せしめると流入ゾーンでことに設 置された超音波発生装置をにて300~500 KHz の比較的周波数の高い超音波が流入汚水に向って 照射されるため流入ゾーンより沈降ゾーンへ流入 しようとする路子の一種で報毛を有して遊泳でよる 設定する路子のでででで変毛を対して変化である。 設定する路子にて発生する過酸化水素による 設定する路子になった。そして必要化水素 の影響から速走子は沈降ゾーンへ流入されな降促 進板に付着する。この沈降促進板に着床し、発

超音波を二段標えにて照射することにより完全に 沈降促進板への後の発生、付着を防止することが でき、沈股効率が高く、かつ、維持管理上の問題 の少い沈設備を提供することができる等の利点を 有する。

なか、構成の中で、発生装置を移動させてもよいとしたのは、特にキャピテーションによる発剤作用を目的とする超音波の場合、常時、沈降促進板に照射してかく必要はなく第4図に示すように実際の下水処理物の最終沈殿池で実験を行った結果、4日間放置して楽の発生した板に超音波(異波数28 KHz、音波出力 Q. 9 W/cm²)を 7 分間照射することで強んど完全に除去できることが確認できている。

4.図面の簡単な説明

第1回は凝断側面図、第2回は第1四A-A 単による断面図、第3回は同B-B 単による断面図、第4回は本発明による悪の除去効果を示すグラフ図である。

1 … 优胶槽

2 … 進入口

3 … 催出口

4…沈降促進权

5 … 仕切板

4.7.4.超音波异生要量

特許出順人 日立機電工業株式会社 代 理 人 林 清 明 外 1 名

